RAF ALD

1er Workshop **R**éseau des **A**cteurs **F**rançais de l'ALD

16 -17 -18 Novembre 2015

Minatec et Campus Est, Grenoble, France

Ce premier **Workshop,** dédié à la technologie **ALD** (Atomic Layer Deposition), a pour but de fédérer une communauté française, industrielle et académique, afin d'initier la **création** d'un **réseau national**.

Domaines **M**icroélectronique, **E**nergie, **T**extile, **B**iologie, **N**anotechnologies...
Public **C**hercheurs, **E**nseignants, **I**ngénieurs, **D**octorants, **T**echniciens, **E**tudiants

Soumission des résumés: date limite 30 septembre 2015

www.rafald.org

Frais d'inscription :
100€ / 60€ (doctorants)
Limité à 100 places
Contact: rafald@simap.grenoble-inp.fr

Programme

Lundi 16

MINATEC CAMPUS	13.00 - 14.00	**A**ccueil
	14.00 - 14.30	**I**ntroduction
	14.30 - 17.00	**T**utoriels, Historique et principes de base de l'ALD (F. Donsanti), Précurseurs (S. Danièle), Equipements (J. Kools), Applications actuelles et émergentes (C. Vallée)
	17.00 - 19.00	**S**ession Posters

Mardi 17

MINATEC CAMPUS	08.00 - 12.30	**S**imulations et Précurseurs
	14.30 - 19.00	**C**roissance, Caractérisations et Applications émergentes
	20.00 - 23.00	**D**îner de Gala

Mercredi 18

CAMPUS EST	09.00 - 12.30	**P**résentation du Labex CEMAM, Equipements ALD
	14.00 - 16.00	**C**onstruction du Réseau RAFALD, Réseau EU COST HERALD

Comite scientifique

N. Bahlawane (LIST) - S. Bellardie (Air Product)
D. Blanc-Pelissier (INL) - N. Blasco (Air Liquide)
M. Cassir (Chimie Tech Paris) - S. Daniele (IRCELYON)
J.-M. Decams (Annealsys) - F. Donsanti (EDF)
A. Esteve (LAAS) - M. Gros-Jean (STMicroelectronics)
J. Kools (Encapsulix) - F. Neuilly (IEMN)
P. Carroy (INES) - L. Santinacci (CINAM)
C. Valhas (CIRIMAT) - J. Vitiello (Altatech)

Comite local

E. Blanquet (SIMaP) - R. Boichot (SIMaP)
L. Cagnon (Institut NEEL) - R. Gassilloud (CEA/Leti)
C. Jiménez (LMGP) - T. Maindron (CEA/Leti)
A. Mantoux (SIMaP) - D. Muñoz-Rojas (LMGP)
C. Vallée (LTM)